

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/052683 A1

(51) 国際特許分類⁷: **G02F 2/02**
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017468
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 25 日 (25.11.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2003-394218
2003 年 11 月 25 日 (25.11.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 国立大
学法人 大阪大学 (OSAKA UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒
5650871 大阪府吹田市山田丘 1 番 1 号 Osaka (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 久武 信太郎

(HISATAKE, Shintaro) [JP/JP]; 〒5600055 大阪府豊
中市柴原町 5-9-1 6-2 O 1 Osaka (JP). 小林 哲郎
(KOBAYASHI, Tetsuro) [JP/JP]; 〒6650871 兵庫県宝塚
市中山五月台 2-3-4 Hyogo (JP).

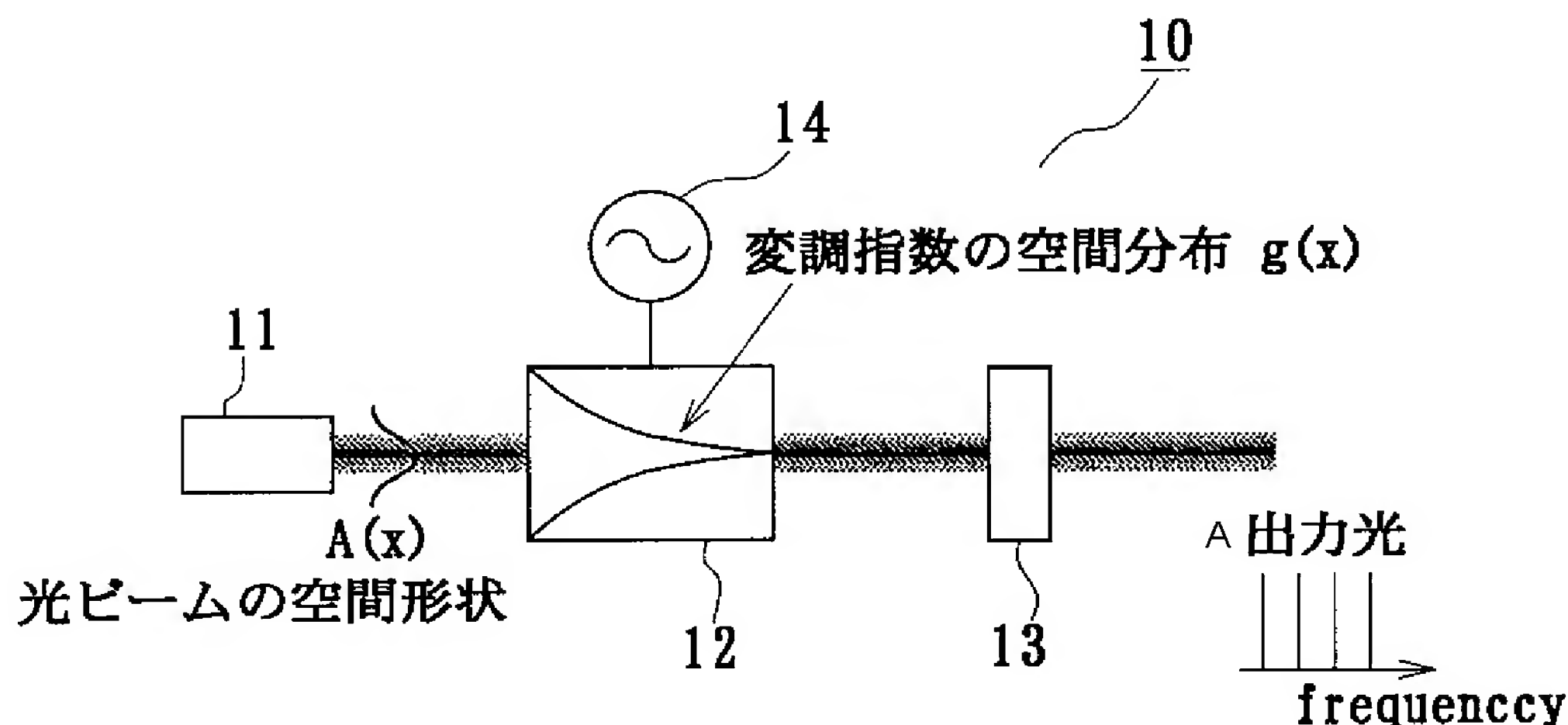
(74) 代理人: 杉村 興作 (SUGIMURA, Kosaku); 〒1000013
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 4 号 霞山ビルディ
ング 7 F Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: BROAD BAND LIGHT SIDE BAND GENERATING METHOD, AND BROAD BAND LIGHT SIDE BAND GEN-
ERATING DEVICE

(54) 発明の名称: 広帯域光サイドバンド生成方法、及び広帯域光サイドバンド生成装置



A(x) LIGHT BEAM SPATIAL SHAPE
g(x) MODULATION INDEX SPATIAL DISTRIBUTION
A OUTPUT LIGHT

(57) Abstract: A light beam is input to an electrooptic phase modulator from a laser light source to subject the light beam to phase modulation, and a specified phase modulation index spatial distribution is set so as to offset the spatial distribution of the light beam, thereby generating a light side-band row having a uniform intensity distribution.

(57) 要約: レーザ光源より電気光学位相変調器に光ビームを入力し、前記光ビームに対して位相変調を加えると
ともに、前記光ビームの空間分布を相殺するような所定の位相変調指数空間分布を設定し、一様な強度分布を有す
る光サイドバンド列を生成する。

WO 2005/052683 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

広帯域光サイドバンド生成方法、及び広帯域光サイドバンド生成装置 技術分野

[0001] 本発明は、広帯域光サイドバンド生成方法、及び広帯域光サイドバンド生成装置に関する。

背景技術

[0002] 光サイドバンドを生成するための手法としては、従来よりモードロックレーザ (MLL) を用いる方法と、外部位相変調器を用いる方法とが利用されてきた。MLLを用いる方法としては、非線形光ファイバーと併用して2オクターブに亘る帯域の光サイドバンドの生成が実証されているが、この方法で生成される光サイドバンド列の周波数間隔は数百MHz程度と狭く、光通信システムなどへは十分に応用することができなかった。また、前記光サイドバンド列の周波数間隔を電氣的に制御することも容易でなかった。さらに、MLLは一般に大きく高価であるために、産業基盤に適用可能な基本機器としては非常に扱い難いなどの問題点もあった。

[0003] 一方、外部位相変調器を用いる方法では、光サイドバンド列の周波数間隔を十分に大きく、例えば10GHz以上とすることができ、かつコンパクトで広範囲の光源が利用できるという利点を有する。また、サイドバンド列の間隔を容易に電氣的に調製することができる。しかしながら、各サイドバンド成分の振幅はベッセル関数に従うため均一性に乏しく、ある特定次数のサイドバンド強度がゼロになる場合が生じる。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0004] 本発明は、十分に大きい周波数間隔を有し、かつそれぞれが均一な強度を有する光サイドバンド列を生成することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0005] 本発明は、
所定の光源より電気光学位相変調器に光ビームを入力する工程と、
前記電気光学位相変調器において、前記光ビームに対して位相変調を加え、光サ

イドバンド列を形成する工程と、

前記電気光学位相変調器において、前記光ビームの空間分布を考慮した所定の位相変調指数空間分布を設定し、前記光サイドバンド列の強度分布を一樣とする工程と、

を具えることを特徴とする、広帯域光サイドバンド生成方法に関する。

[0006] また、本発明は、

所定の光源と、

前記光源より出射された光ビームに対して位相変調を加え、光サイドバンド列を形成するとともに、前記光ビームの空間分布を考慮した所定の位相変調指数空間分布を設定し、前記光サイドバンドの強度分布を一樣とするための電気光学位相変調器と、

を具えることを特徴とする、広帯域光サイドバンド生成装置に関する。

[0007] 本発明によれば、光サイドバンド列を生成するに際し、外部位相変調器としての電気光学位相変調器を用いているので、前記光サイドバンド列の周波数間隔は前記位相変調器における位相変調周波数に応じて任意に制御することができる。したがって、前記位相変調周波数を例えば数GHzまで増大させれば、前記光サイドバンド列の周波数間隔を十分に増大させることができるようになる。

[0008] また、前記電気光学位相変調器においては、前記光サイドバンド列を生成するために使用する光ビームの空間分布を考慮して所定の位相変調指数の空間分布を設定し、位相変調で生成されるサイドバンドの不均一性を平均化するようにしているので、前記光サイドバンド列の強度分布を一樣とすることができる。

[0009] したがって、本発明によれば、従来のMLLと非線形素子を用いる方法では困難であった、目的とする光サイドバンド列の周波数間隔を十分に増大させることができるとともに、従来の外部位相変調器を用いる方法では不可能であった、前記光サイドバンド列の強度分布の一樣化を達成することができる。

[0010] 前記位相変調指数空間分布は、例えば位相変調に使用する変調波の周波数が十分に低く、前記電気光学位相変調器において、前記光サイドバンド列を生成させるために使用する光ビームと、前記変調波との速度非整合が問題とならない場合は、

前記位相変調器における電極形状を制御することによって実現する。具体的には、前記電極形状を前記位相変調指数空間分布の形状と合致するようにして形成する。

[0011] なお、前記電極は、前記電気光学位相変調器を構成する電気光学結晶の、前記光ビームの進行方向と略平行な相対する一対の主面上に設けられている。

[0012] 一方、位相変調に使用する周波数が、例えば数GHzまで増大し、前記電気光学位相変調器において前記光サイドバンド列を生成させるために使用する光ビームと、前記変調波との速度非整合が問題となる場合は、前記位相変調器において分極反転技術を施すことによって、前記光ビームと前記変調波との疑似的な速度整合を採るようにする。

[0013] なお、前記分極反転技術は、前記位相変調器を構成する電気光学結晶に対して行う。前記電気光学結晶は、前記位相変調器を構成する主材料であって、その大部分を構成するものである。

[0014] 前記電気光学位相変調器の後方において空間フーリエ変換手段を設け、前記電気光学位相変調器によって光ビーム断面内で様々な変調指数で変調され、各変調指数に応じた光サイドバンド列を含む光ビームを空間フーリエ変換により合算する。これによって、前記光サイドバンド列を有する前記光ビームの強度を常に一定とすることができる。

[0015] なお、前記光ビーム出力を外部に取り出すためには、前記電気光学位相変調器の後方、又は前記空間フーリエ変換手段を設けた場合はその手段の後方に適宜に出力手段を設ける。

発明の効果

[0016] 以上説明したように、本発明によれば、十分に大きい周波数間隔を有し、かつそれぞれが均一な強度を有する光サイドバンド列を生成することができる。

図面の簡単な説明

[0017] [図1]本発明の広帯域光サイドバンド生成装置の一例を概略的に示す構成図である。

[図2]本発明の広帯域光サイドバンド生成装置の他の例を概略的に示す構成図である。

[図3]図2に示す広帯域光サイドバンド生成装置の変形例を概略的に示す構成図である。

[図4]図2に示す広帯域光サイドバンド生成装置のさらに他の変形例を概略的に示す構成図である。

発明を実施するための最良の形態

[0018] 以下、本発明の詳細、並びにその他の特徴及び利点について、最良の形態に基づいて詳細に説明する。

[0019] 図1は、本発明の広帯域光サイドバンド生成装置の一例を概略的に示す構成図である。図1に示すサイドバンド生成装置10においては、レーザ光源11と、その後方において、電気光学位相変調器12及び光ビーム出力手段13とが順次に設けられている。また、電気光学位相変調器12には、高周波電源14が接続されている。

[0020] レーザ光源11より所定の空間分布 $A(x)$ を有する光ビームが出射され、電気光学位相変調器12内に導入されると、前記光ビームは高周波電源14からの変調波によって変調を受ける(変調波が重畳される)。このとき、前記光ビーム内には、低次のサイドバンドから高次のサイドバンドまでの複数のサイドバンド(サイドバンド列)が形成される。

[0021] 従来の方法では、位相変調指数がビーム全体に亘り一定であるため、その変調指数に対応したベッセル関数状の不均一な変調サイドバンドが生成され特定の次数のサイドバンドではその強度がほとんどゼロとなる場合があった。これに対して、本願発明では、電気光学位相変調器12内に位相変調指数の空間分布 $g(x)$ を形成し、異なる変調指数のサイドバンドが前記光ビームの空間分布 $A(x)$ の重み付けをもって合算しサイドバンド列の強度が一様になるにしている。その結果、均一な強度の光サイドバンド列が得られるようになる。

[0022] 位相変調指数の空間分布 $g(x)$ を考慮した場合、前記変調波の周波数を f_m 及び時間を t とすることによって、前記光ビームは $\phi(t, x) = g(x) \sin(2\pi f_m t)$ なる位相変調を受けることになる。したがって、前記光ビームの周波数を f_0 とすると、前記光ビームは、
[数1]

$$A(x) \exp[j(2\pi f_0 t - g(x) \sin(2\pi f_m t))] = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} A(x) J_n(g(x)) \exp[j(2\pi(f_0 - n f_m)t)]$$

で表され、結晶出力端の位置 x において変調周波数毎に並んだサイドバンド列となる。このとき、各サイドバンドの振幅(強度)は、 $A(x)J_n(g(x))$ で表されるので、この式に基づいて各 n 値に対応した各サイドバンドの振幅(強度)が一定となるように位相変調指数空間分布 $g(x)$ を決定する。

[0023] 高周波電源14から印加される前記変調波の周波数が比較的小さく、前記光ビームとの速度非整合が問題とならないような場合は、電気光学位相変調器12内の電極形状を制御することによって、所望する位相変調指数空間分布 $g(x)$ を実現する。具体的には、前記電極の形状を位相変調指数空間分布 $g(x)$ と合致するようにして形成する。なお、前記電極は、前記電気光学位相変調器を構成する電気光学結晶の、前記光ビームの進行方向と略平行な相対する一対の主面上に設けられている。

[0024] また、高周波電源14から印加される前記変調波の周波数が比較的高く、例えば数GHzのオーダーである場合は、電気光学位相変調器12を構成する電気光学結晶に分極反転技術を施し、一定の周期の下、ある幅 W で前記電気光学結晶の結晶軸を反転させる。

[0025] 具体的に、前記変調波の周波数を f_m 、前記光ビームの群速度を V_{gopt} 、変調波の位相速度を V_{pmod} とすると、 $L=[2f_m(1/V_{gopt}-1/V_{pmod})]^{-1}$ なる半周期で分極反転させることが好ましい。このとき、前記光ビームが、例えばガウス分布に従うものであって、 nm を前記電気光学結晶の電界印加による屈折率変化、 λ を前記光ビームの波長、 L を前記分極反転周期、及び $W(x)$ を位置 x に依存する分極反転幅とすると、距離 $2L$ ごとの変調指数の空間分布 $g(x)=8nmL/\lambda \sin(\pi W(x)/(2L))$ となる。

[0026] なお、電気光学位相変調器12内において、前記電気光学結晶は、前記位相変調器を構成する主材料であって、その大部分を構成するものである。

[0027] 図2は、本発明の広帯域光サイドバンド生成装置の他の例を概略的に示す構成図である。図2に示すサイドバンド生成装置20は、電気光学位相変調器12の後方で空間フーリエ変換手段としての凸レンズ21を有し、さらにその後方でスリット22Aを有する回折板22及び追加の凸レンズ23を有している点で図1に示すサイドバンド生成装置10と異なり、その他の構成要素については同一である。したがって、レーザ光源11から出射された光ビームの位相変調も同一に行われ、所定の光サイドバンド列を得

ることができるようになる。なお、回折板22及び追加の凸レンズ23は、前記光ビーム出力に対する出力手段を構成する。

[0028] 電気光学位相変調器12の後方において空間フーリエ変換手段としての凸レンズ21を設け、電気光学位相変調器12によって光ビーム断面内で様々な変調指数で変調され、各変調指数に応じた光サイドバンド列を含む光ビームを空間フーリエ変換としての凸レンズ21により合算する。これによって、前記光サイドバンド列を有する前記光ビームの強度を常に一定とすることができる。

[0029] なお、回折板22は、スリット22Aが凸レンズ21の焦点fと合致するように配置し、前記光ビーム出力は凸レンズ21を通過した後、スリット22Aで絞り込まれ、再度追加の凸レンズ23を介して外部に出力される。

[0030] また、前記空間フーリエ変換手段としては、凸レンズ23に代えて凹面鏡を用いることもできる。

[0031] 図3は、図2に示す広帯域光サイドバンド生成装置の変形例を概略的に示す構成図である。図3に示す広帯域光サイドバンド生成装置30においては、図2に示す出力手段としての回折板22及び追加の凸レンズ23に代えて、光ファイバ31を設けている。光ファイバ31は、その入力端が空間フーリエ変換手段としての凸レンズ21の焦点距離fに合致するようにする。この場合は、得られた光サイドバンド列を含む光ビーム出力を凸レンズ21で空間フーリエ変換した後、光ファイバ31内に導入して外部に取り出す。

[0032] 図4は、図2に示す広帯域光サイドバンド生成装置のさらに他の変形例を概略的に示す構成図である。図4に示す広帯域光サイドバンド生成装置40においては、図2に示す出力手段としての回折板22及び追加の凸レンズ23に代えて、回折格子41を設けている。この場合は、得られた光サイドバンド列を含む光ビーム出力を凸レンズ21で空間フーリエ変換した後、回折格子41で回折し、外部に取り出す。

[0033] 以上、具体例を挙げながら発明の実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明してきたが、本発明は上記内容に限定されるものではなく、本発明の範疇を逸脱しない限りにおいてあらゆる変形や変更が可能である。例えば、上記例においてはレーザ光源を用いているが、任意の光源を用いることができる。また、位相変調指数空間分

布 $g(x)$ を適宜に選択することにより、任意の分布形状の光ビームをも用いることができる。

- [0034] 例えば、本願発明では、サイドバンド列の強度分布が一様となるようにしたが、同様の考え方に従えば、必ずしも平坦なサイドバンド分布だけにとどまらず、あらゆる強度エンベロープを持つ光サイドバンド列が生成可能となる。

産業上の利用可能性

- [0035] 本発明は、光エレクトロニクス、光情報処理、光通信、光計測、及び光記録などの分野において使用することができ、具体的には、光周波数シンセサイザ、光パルスシンセサイザ、光周波数コム発生器、超短パルス生成器、及び波長多重用光源などに適用することができる。

請求の範囲

- [1] 所定の光源より電気光学位相変調器に光ビームを入力する工程と、
前記電気光学位相変調器において、前記光ビームに対して位相変調を加え、光サイドバンド列を形成する工程と、
前記電気光学位相変調器において、前記光ビームの空間分布を考慮した所定の位相変調指数空間分布を設定し、前記光サイドバンド列の強度分布を一様とする工程と、
を具えることを特徴とする、広帯域光サイドバンド生成方法。
- [2] 前記位相変調指数空間分布は、前記電気光学位相変調器における電極形状を制御することによって形成することを特徴とする、請求項1に記載の広帯域光サイドバンド生成方法。
- [3] 前記位相変調指数空間分布は、前記電気光学位相変調器において分極反転技術を施すことによって形成することを特徴とする、請求項1に記載の広帯域光サイドバンド生成方法。
- [4] 前記分極反転技術は、前記電気光学位相変調器における電気光学結晶の結晶軸を $L=[2f_m(1/V_{gopt}-1/V_{pmod})]^{-1}$ (f_m :変調周波数、 V_{gopt} :光ビームの群速度、 V_{pmod} :変調波の位相速度)なる周期で反転させることによって実施することを特徴とする、請求項3に記載の広帯域光サイドバンド生成方法。
- [5] 前記位相変調指数空間分布は、 $g(x)=8nmL/\lambda \sin(\pi W(x)/(2L))$ (nm :電気光学結晶の位相変調に基づく屈折率変化、 λ :光ビームの波長、 L :分極反転周期、 $W(x)$:分極反転幅)なる式で表されることを特徴とする、請求項4に記載の広帯域光サイドバンド生成方法。
- [6] 前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を、前記電気光学位相変調器を出射した後に、空間フーリエ変換する工程を具えることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一に記載の広帯域光サイドバンド生成方法。
- [7] 前記空間フーリエ変換は凸レンズを用いて行うことを特徴とする、請求項6に記載の広帯域光サイドバンド生成方法。
- [8] 前記空間フーリエ変換は凹面鏡を用いて行うことを特徴とする、請求項6に記載の

広帯域光サイドバンド生成方法。

[9] 所定の光源と、

前記光源より出射された光ビームに対して位相変調を加え、光サイドバンド列を形成するとともに、前記光ビームの空間分布を考慮した所定の位相変調指数空間分布を設定し、前記光サイドバンド列の強度分布を一様とするための電気光学位相変調器と、

を具えることを特徴とする、広帯域光サイドバンド生成装置。

[10] 前記電気光学位相変調器は、前記位相変調指数空間分布を生成するために所定の形状に制御された電極を有することを特徴とする、請求項9に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

[11] 前記電気光学位相変調器は、前記位相変調指数空間分布を生成するための分極反転技術が施されたことを特徴とする、請求項10に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

[12] 前記分極反転技術は、前記電気光学位相変調器における電気光学結晶の結晶軸を $L = [2f_m(1/V_{gopt} - 1/V_{pmod})]^{-1}$ (f_m : 変調周波数、 V_{gopt} : 光ビームの群速度、 V_{pmod} : 変調波の位相速度) なる周期で反転させたことを特徴とする、請求項11に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

[13] 前記位相変調指数空間分布は、 $g(x) = 8nmL / \lambda \sin(\pi W(x) / (2L))$ (nm : 電気光学結晶の位相変調に基づく屈折率変化、 λ : 光ビームの波長、 L : 分極反転周期、 $W(x)$: 分極反転幅) なる式で表されることを特徴とする、請求項12に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

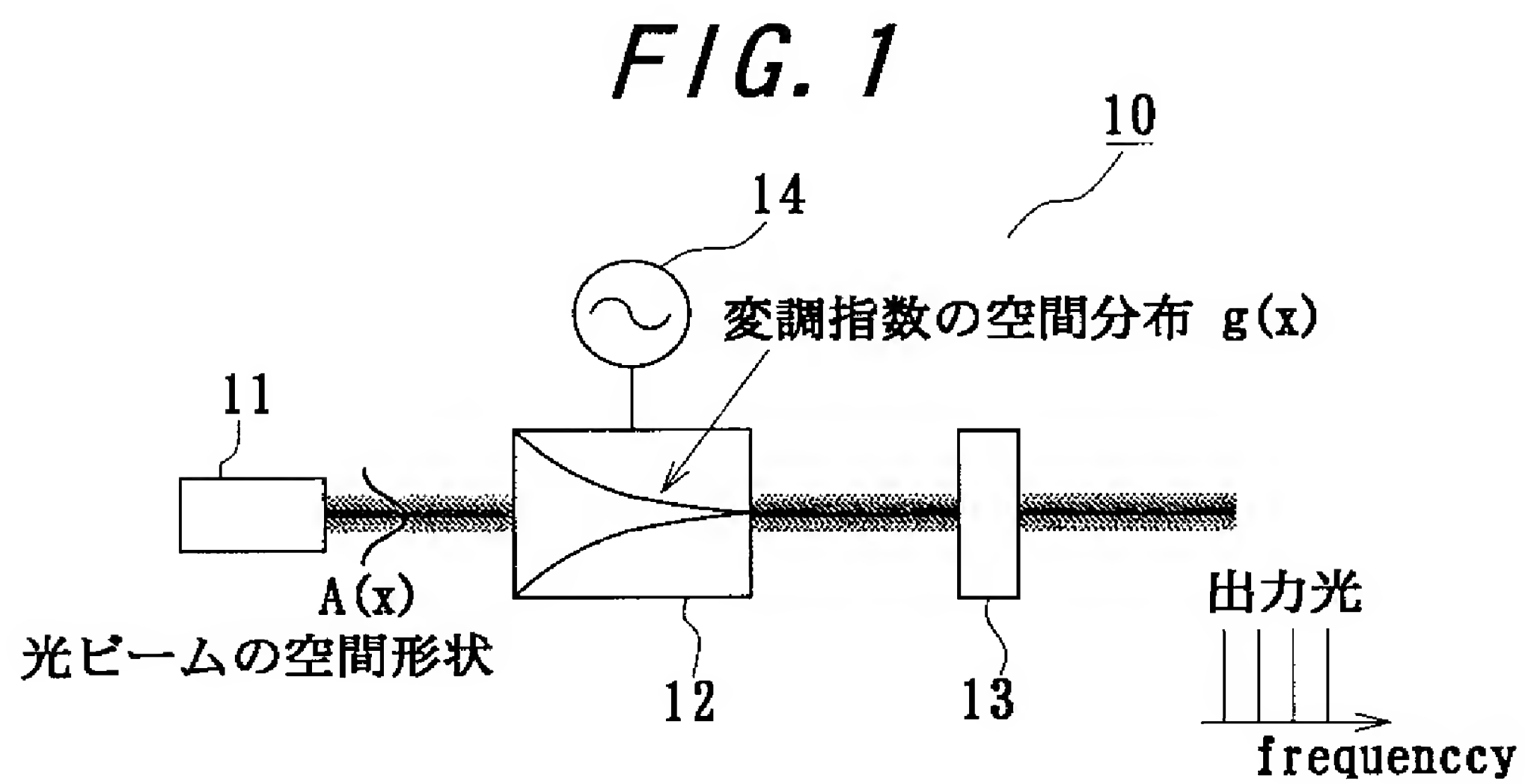
[14] 前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を、前記電気光学位相変調器を出射した後に、空間フーリエ変換するための空間フーリエ変換手段を具えることを特徴とする、請求項9～13のいずれか一に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

[15] 前記空間フーリエ変換手段は凸レンズを含むことを特徴とする、請求項14に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

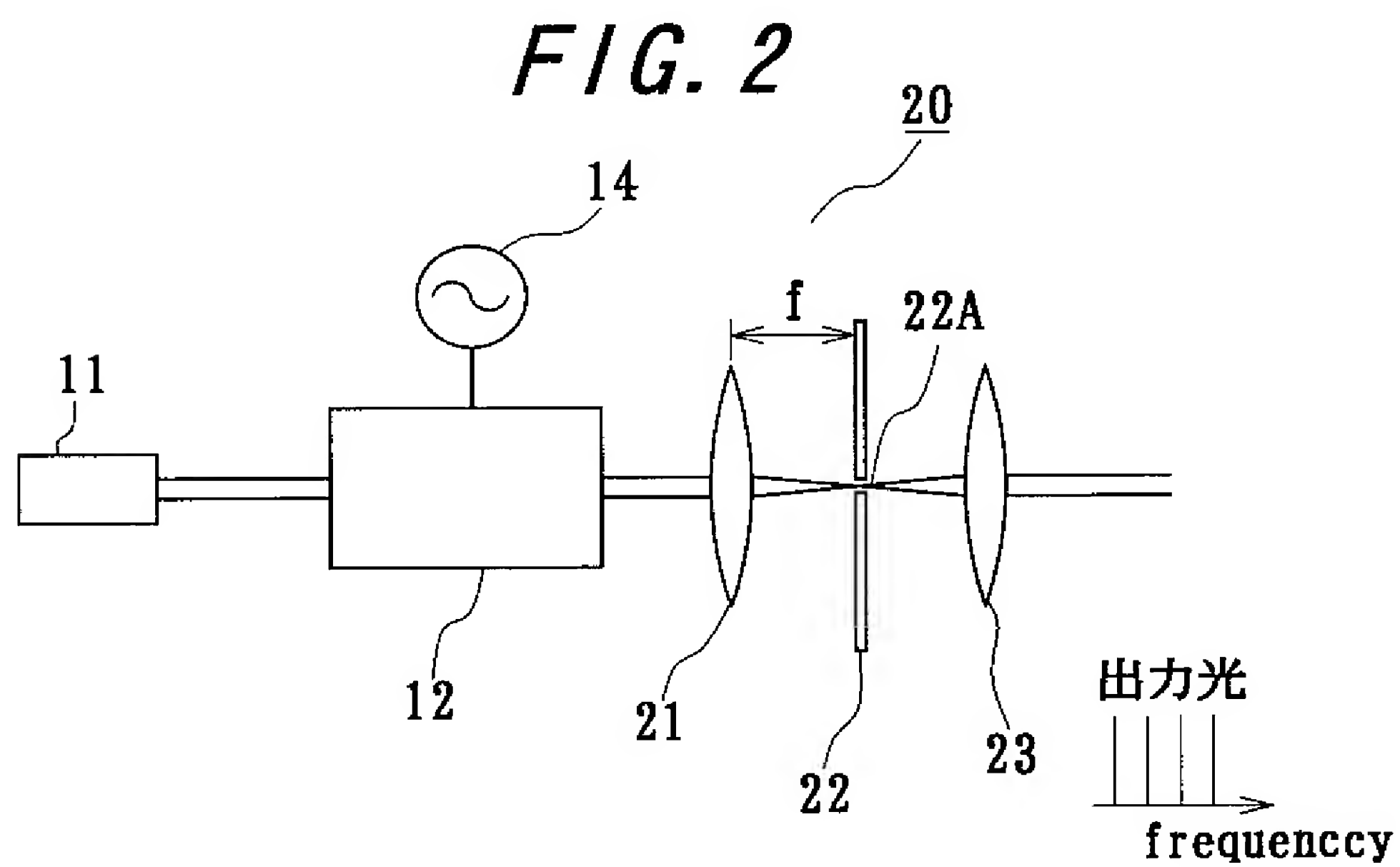
[16] 前記空間フーリエ変換手段は凹面鏡を含むことを特徴とする、請求項14に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

- [17] 前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を出力させるための光ビーム出力手段を具備することを特徴とする、請求項9～16のいずれかーに記載の広帯域光サイドバンド生成装置。
- [18] 前記光ビーム出力手段は回折格子を含むことを特徴とする、請求項17に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。
- [19] 前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を出力させるための光ビーム出力手段を具備、前記光ビーム出力手段は、前記凸レンズの焦点位置にスリットが配置された回折板と追加の凸レンズとから構成されたことを特徴とする、請求項15に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。
- [20] 前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を出力させるための光ビーム出力手段を具備、前記光ビーム出力手段は、光ファイバから構成されたことを特徴とする、請求項15に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

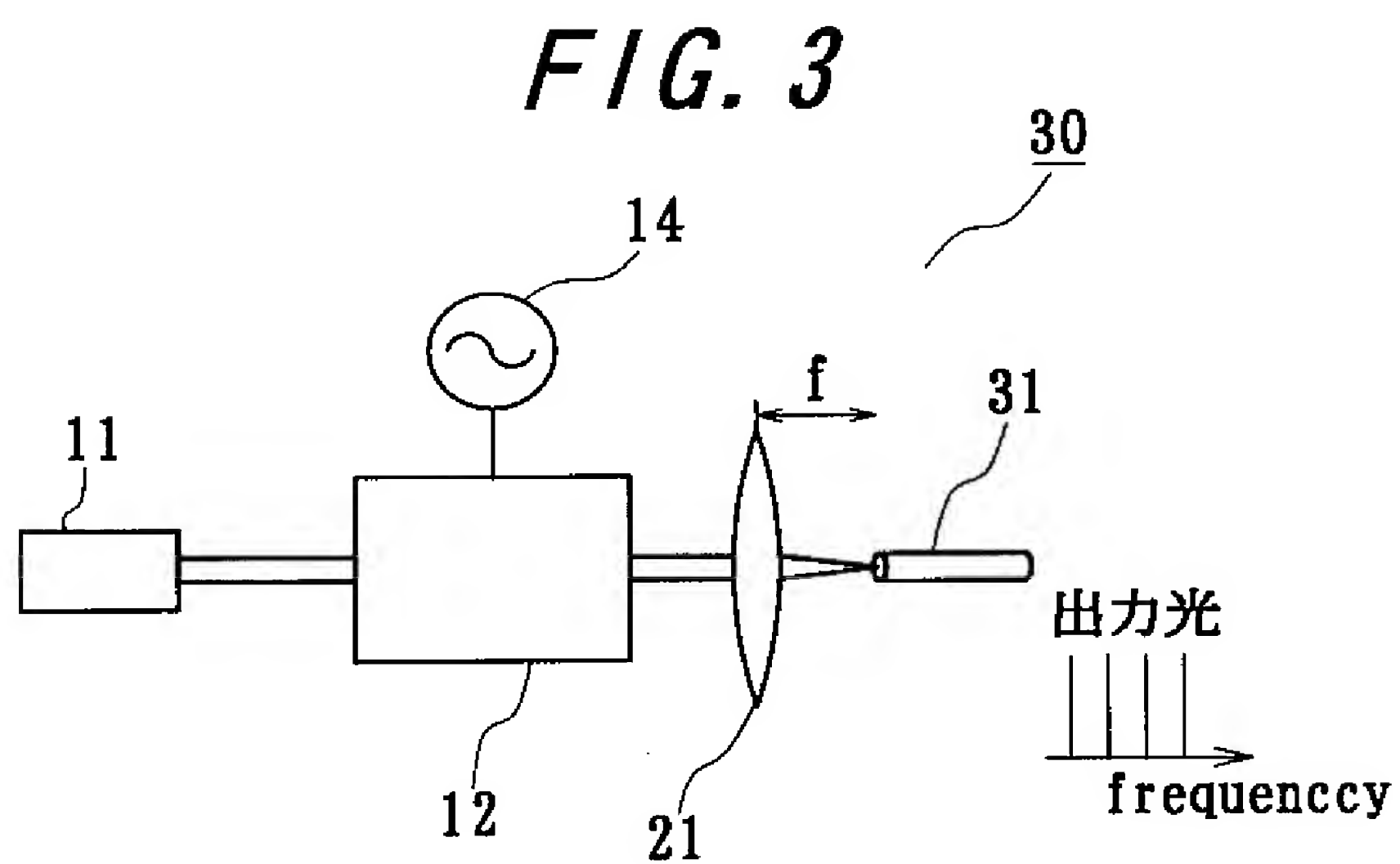
[図1]



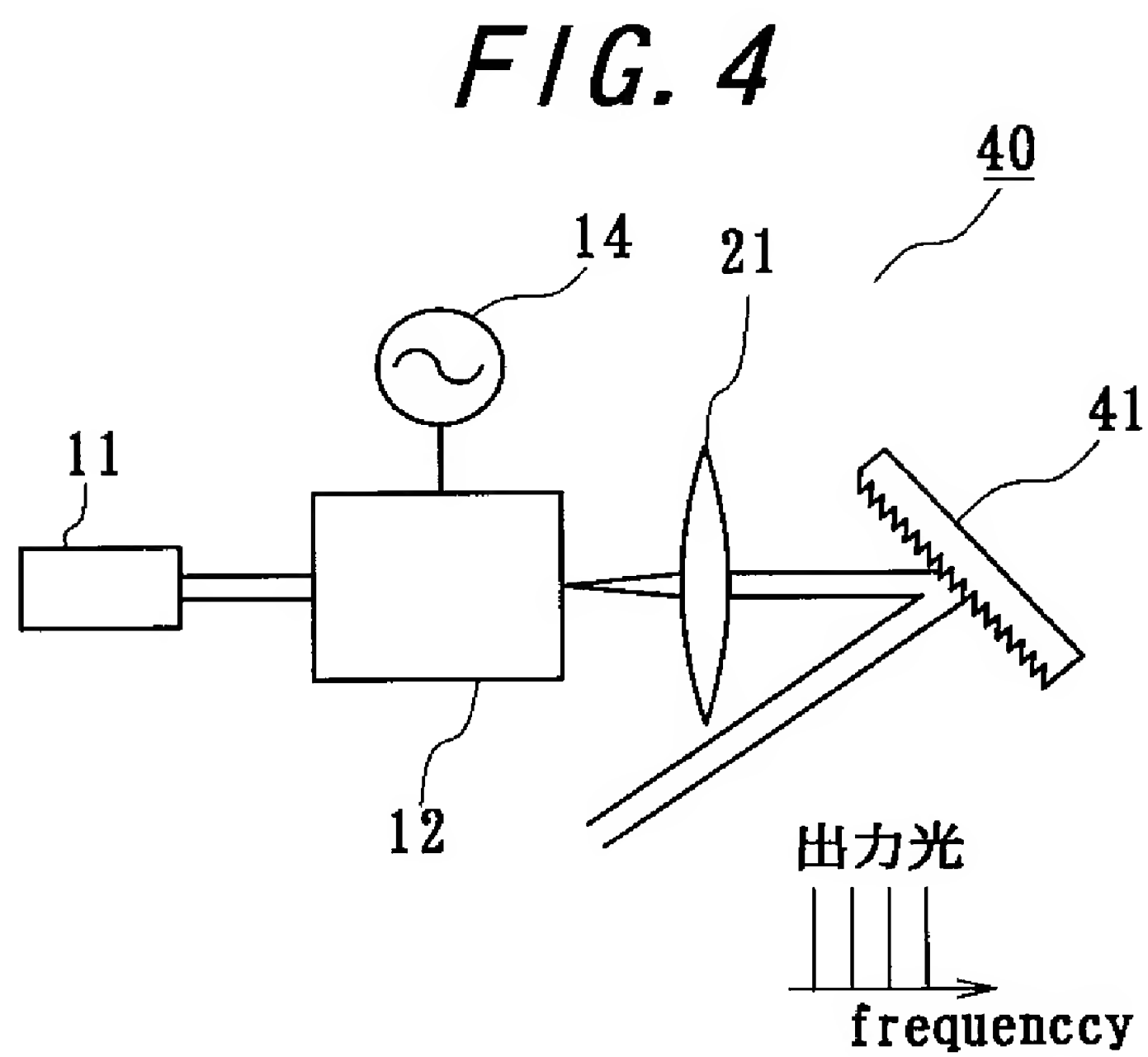
[図2]



[図3]



[図4]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/017468

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ G02F2/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G02F2/02, G02F1/03

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JICST

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 11-109299 A (President of Osaka University), 23 April, 1999 (23.04.99), (Family: none)	1, 2, 6-10, 14-17, 20 3-5, 11-13, 18, 19
Y	Khayim, T. et al., A Novel Ultrahigh-Speed Electrooptic Lens with Periodic Domain Inversion, Optical Review, Vol.7, No.2 (2000), pages 115 to 118	3-5, 11-13, 18, 19
Y	Tetsuro KOBAYASHI, "Bunkyo Hanten Kozo o Mochiita Hikarihenchoki no Shintenkai", Dai 48 Kai Oyo Butsurigaku Kankei Rengo Koenkai Koen Yokoshu (2001), separate Vol.0, page 83, 29p-ZV-2	3-5, 11-13

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
22 February, 2005 (22.02.05)

Date of mailing of the international search report
08 March, 2005 (08.03.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02F2/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02F2/02 G02F1/03

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JICST

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 11-109299 A (大阪大学長) 1999. 04. 23 (ファミリーなし)	1, 2, 6-10, 14-17, 20
Y		3-5, 11-13, 18, 19
Y	Khayim, T. et al. A Novel Ultrahigh-Speed Electrooptic Lens with Periodic Domain Inversion, Optical Review, Vol.7, No.2(2000), p. 115-118	3-5, 11-13, 18, 19

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22. 02. 2005

国際調査報告の発送日

08. 3. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

佐藤 宙子

2 X

9 3 1 6

電話番号 03-3581-1101 内線 3293

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	小林哲郎, 分極反転構造を用いた光変調器の新展開, 第48回応用物理学関係連合講演会講演予稿集(2001), 第0分冊, 第83頁, 29p-ZV-2	3-5, 11-13